

請求の範囲

- [請求項1] 酸化マグネシウム焼結体からなるスパッタリングターゲットであって、前記酸化マグネシウム焼結体の一つの結晶粒内にピンホールの数
が20個以上存在する結晶粒の割合が50%以下であることを特徴とするスパッタリングターゲット。
- [請求項2] 抗折力が150MPa以上であることを特徴とする請求項1記載の
スパッタリングターゲット。
- [請求項3] 平均結晶粒径が30 μ m以上400 μ m以下であることを特徴とする
請求項1又は2記載のスパッタリングターゲット。
- [請求項4] 相対密度が99.7%以上であることを特徴とする請求項1～3の
いずれか一項に記載のスパッタリングターゲット。